

國立彰化師範大學共同儀器中心

自旋科技中心 離子濺鍍系統對外服務辦法

一、儀器名稱：

中文名稱：離子濺鍍系統

英文名稱：Ion beam sputter

二、儀器廠牌、型號與購置年份：

廠牌及型號：ELIONIX EIS-220W

購置年份：民國 95 年

三、儀器重要規格：

1. Ion gun system: Microwave power generator MR203 (100W)
2. Ionization gas: Ar, O₂
3. Acceleration voltage controller: 30V~3000V
4. Ion current stability: ±3% / 2hr
5. Vacuum ~10⁻⁴Pa
6. Specimen size: 4 inches
7. Water cooling system 15~30°C
8. Power source: single phase AC100V±10%, 3kVA 50/60Hz

四、放置地點：

進德校區格致館：奈米暨低溫件實驗室(3F)

五、儀器相關人員：

儀器負責教授	吳仲卿 教授	(04) 7232105 ext. 3343
儀器管理人	林子邑 同學	(04) 7232105 ext. 3313 w0919161025@hotmail.com

六、服務項目：

1. 濺鍍奈米至次微米層級金屬薄膜。

七、機台使用辦法：

本機台僅提供委託操作方式。由本中心指派合格人員代為操作儀器。

八、服務時間：

1. 本系統服務以二小時為一時段，最少預約 1 時段。每週開放 12 時段受理委託操作申請，操作時段為週三至週五：上午 08:00~12:00；下午 13:00~17:00，其餘時段僅供本中心設備維護、人員訓練或計畫執行之用。
2. 對外開放時段，若因設備維護或技術訓練等事宜，得暫停開放。
3. 詳細開放時間逕洽儀器管理人。

九、申請辦法與規定事項：

1. 申請服務最遲須於一周提出，否則不予受理。
2. 取消預約最遲須於前 3 日提出，否則仍應按申請時段繳交費用。
3. 申請人請自行與儀器管理人接洽委託操作事宜。儀器操作人得視需要，要求申請人在現場共同進行實驗。

十、其他相關規定及懲處：

1. 若於預約當日，無法如期到場，仍無用電話事先取消該預約時段，累計 2 次以上，暫停該預約單位 1 個月的預約權。
2. 未經許可私自帶走本實驗室任何物品者，提報指導教授與實驗室負責人另議懲處。

十一、收費標準：

項目	校外學術單位	產業界
費用	2500 元 / 次	5000 元 / 次
備註	1.由委託者自行準備小於四吋之基板，本中心不提供基板。 2.一次以兩小時為單位，若因鍍膜厚度太厚需增長時間，以兩小時為單位收費。 3.提供濺鍍靶材：Cu, Al, NiFe, GST, TiN, Ta	